


32

中华人民共和国国家知识产权局

邮政编码: 100037 北京市阜成门外大街2号万通新世界广场8层 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 王以平		发文日期 <div>专利局 2004.11.5 发文</div>
E020122 申请号: 021062994		
申请人: 富士通株式会社		
发明创造名称: 制造具有碳化硅膜的半导体器件的方法		

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第35条第1款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。
☐ 根据专利法第35条第2款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
2. ☒ 申请人要求以在:
- JP 专利局的申请日 2001年10月10日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日。
- ☒ 申请人已经提交了经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本。
☐ 申请人尚未提交经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第30条的规定视为未提出优先权要求。
3. ☐ 经审查, 申请人于:
年 月 日提交的 不符合实施细则第51条的规定;
年 月 日提交的 不符合专利法第33条的规定;
年 月 日提交的
4. 审查针对的申请文件:
☒ 原始申请文件。 ☐ 审查是针对下述申请文件的
- | | | | |
|--------------------|---------------|-------|----|
| 申请日提交的原始申请文件的权利要求第 | 项、说明书第 | 页、附图第 | 页; |
| 年 月 日提交的权利要求第 | 项、说明书第 | 页、附图第 | 页; |
| 年 月 日提交的权利要求第 | 项、说明书第 | 页、附图第 | 页; |
| 年 月 日提交的说明书摘要, | 年 月 日提交的摘要附图。 | | |
5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。
☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。
☒ 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续沿用):
- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 编号 | 文件号或名称 | 公开日期(或抵触申请的申请日) |
| 1 | EP1109221A2 | 2001-6-20 |
6. 审查的结论性意见:
☒ 关于说明书:
☐ 申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。



- ☐说明书不符合专利法第26条第3款的规定。
☐说明书不符合专利法第33条的规定。
☒说明书的撰写不符合实施细则第18条的规定。

☒关于权利要求书:

- ☐权利要求 不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
☐权利要求 不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
☐权利要求 不具备专利法第22条第4款规定的实用性。
☐权利要求 属于专利法第25条规定的不授予专利权的范围。
☐权利要求 不符合专利法第26条第4款的规定。
☒权利要求 11 不符合专利法第31条第1款的规定。
☐权利要求 不符合专利法第33条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第2条第1款关于发明的定义。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第13条第1款的规定。
☒权利要求 5、9 不符合专利法实施细则第20条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第21条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第22条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第23条的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☐申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
☒申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
☐专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

8. 申请人应注意下述事项:

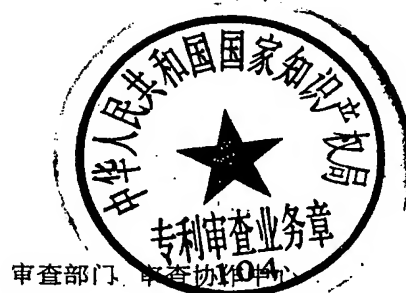
- (1) 根据专利法第37条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。
(2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第33条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
(4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

9. 本通知书正文部分共有 1 页, 并附有下列附件:

- ☒引用的对比文件的复印件共 1 份 11 页。 ☐

审查员: 闫立刚(9530)

2004年10月20日



第一次审查意见通知书正文

申请号：021062994

经审查，具体意见如下：

独立权利要求1与对比文件1相比，其特定技术特征是：使用添加SF₆和NF₃中的至少一个的碳氟化合物气体的混合气体除去加氢的碳化硅膜。

独立权利要求11与对比文件1相比，其特定技术特征是：在四甲基硅烷与二氧化碳的流量比为0.2-0.6的条件下在半导体衬底上化学气相淀积碳化硅膜。

权利要求11与权利要求1的特定技术特征之间在技术上没有任何相关的内容，因此两权利要求在技术上不存在相互关联，没有相同或相应的特定技术特征，不具备单一性，因此权利要求11不符合专利法第三十一条第一款的规定。申请人应当删除该独立权利要求。针对该申请中不再要求保护的发明，申请人可以在该申请结案之前另行提交分案申请。

权利要求5中的术语“氢硅倍半硅氧烷”与说明书第12页第4行的术语“氢倍半硅氧烷”不一致，因此不符合专利法实施细则第二十条第三款的规定。申请人应当对此进行修改。

权利要求9倒数第3段“通过使用部分蚀刻后的第三膜作为掩模，蚀刻第三膜，以在形成第二开口的区域形成到达第一膜的通路孔”，显然上述特征自相矛盾，由此导致权利要求9的内容不清楚，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定。申请人应当将“蚀刻第三膜”改为“蚀刻第二膜”。

与权利要求9同理，该申请说明书第3页倒数第4-3行“通过使用部分蚀刻的第三膜作为掩模，蚀刻第三膜，以形成通路孔”不清楚，不符合专利法实施细则第十八条第三款的规定。申请人应当将“第三膜”改为“第二膜”。

该申请说明书第10页第2行“铜膜33完全L填埋”语句不清楚，不符合专利法实施细则第十八条第三款的规定。申请人应当将其改为“铜膜33L完全填埋”。

基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改，克服所存在的缺陷，则本申请可望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

审查员：闫立刚

代码：9530